

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ GaAs<Te>

Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г.

Изучена температурная зависимость спектров ФЛ, модифицированных лазерным излучением кристаллов GaAs<Te> в интервале температур 77–300 К. Проведено сравнение экспериментальных данных с теорией излучательной рекомбинации СЛКП Левашюка—Осипова. Установлено, что D-полоса, возникающая в модифицированных кристаллах, обусловлена излучательной рекомбинацией через хвосты плотности состояний, которые появляются в результате образования вакансий мышьяка после лазерного воздействия. Оценена эффективная глубина хвостов плотности состояний, которая оказалась 86 мэВ.

1. В работе [1] сообщалось о модификации кристаллов GaAs<Te> излучением импульсного лазера. Было обнаружено, что в спектрах ФЛ при 77 К появляется D-полоса с энергией максимума 1.42 эВ и полушириной 0.09 эВ. Ее интенсивность на порядок превосходила интенсивность краевой полосы исходного кристалла.

Цель настоящей работы — изучение температурной зависимости ФЛ модифицированных кристаллов и выяснение природы D-полосы.

2. ФЛ изучалась в интервале температур 77–300 К. Люминесценция возбуждалась гелий-неоновым лазером ЛГ-75. Уровень возбуждения изменялся в пределах $(4 \div 10) \cdot 10^{17}$ фот/(см²·с). Изменение температуры в процессе записи одного спектра не превышало ± 1 К. Погрешность определения энергии максимума не превышала ± 3 мэВ. Методика лазерной обработки кристаллов описана в работе [1]. Использовались кристаллы GaAs<Te> с концентрацией электронов $(3 \div 6) \cdot 10^{17}$ см⁻³. Для сравнения изучались спектры ФЛ исходных и модифицированных кристаллов.

В спектрах люминесценции исходных кристаллов при 77 К наблюдались две характерные полосы излучения: A-полоса с $h\nu_A \simeq 1.507$ и B-полоса с $h\nu_B \simeq 1.237$ эВ (рис. 1). Известно, что A-полоса (краевая) связана с переходами неравновесных носителей с мелких донорных уровней кремния в валентную зону [2], в то время как B-полоса одними авторами связывается с вакансиями галлия и комплексами типа $V_{Ga} + 3Te$ либо $V_{Ga}Te_{As}$ [3], а другими — со сложными вакансиями мышьяка и их комплексами [4].

Как показал эксперимент, D-полоса в спектрах ФЛ модифицированных кристаллов при низких температурах преобладает над остальными, а при более высоких соизмерима с ними по интенсивности. Поэтому в необходимых случаях производилось выделение D-полосы путем вычитания полос A и B. При этом предполагалось, что температурные изменения этих полос для исходных и модифицированных кристаллов одинаковы, и учитывалось соотношение их интенсивностей и полуширины.

3. После воздействия серией импульсов с суммарной плотностью энергии 80–90 Дж/см² визуально наблюдалось изменение морфологии полированной поверхности кристалла.

Рентгеноструктурный анализ [5], проведенный на этих кристаллах, показал, что на поверхности появляется мелкодисперсный Ga. При этом в спектрах ФЛ при 77 К наблюдаются три перекрывающиеся полосы — A, B и новая D. После стравливания Ga интегральная интенсивность D-полосы увеличивается

на 50–70 % и становится в 5–10 раз (для разных кристаллов) больше интенсивности краевой полосы исходного кристалла.

Эволюция спектров ФЛ при повышении температуры в интервале 77–300 К показана на рис. 1.

При 77 К доминирует асимметричная D -полоса с энергией максимума $h\nu_D \approx 1.42$ эВ, а полосы A и B слабо заметны на ее склонах. С повышением температуры интегральная интенсивность D -полосы быстро падает и при $T > 220$ К она уже не обнаруживается, при этом краевая полоса A при $T > 150$ К становится преобладающей. B -полоса модифицированного кристалла

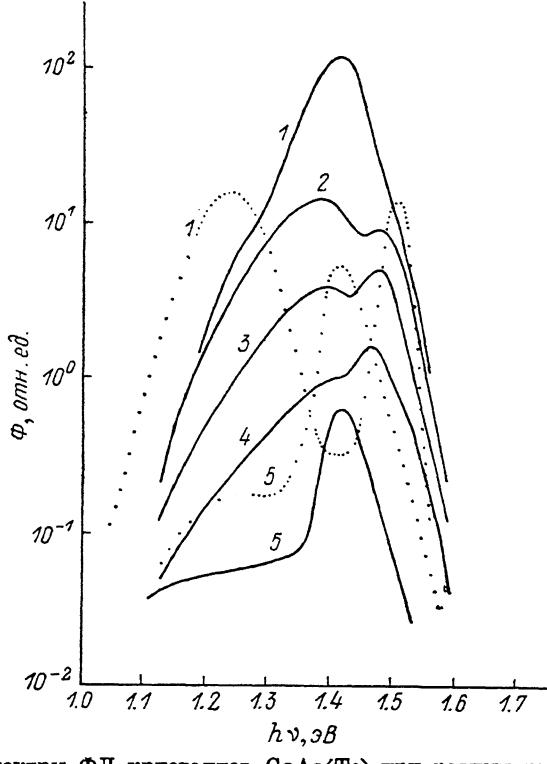


Рис. 1. Спектры ФЛ кристаллов GaAs_xTe_{1-x} при разных температурах.

$T, \text{ К: } 1 - 77, 2 - 140, 3 - 160, 4 - 200, 5 - 300.$ Точки — исходный кристалл, сплошные линии — модифицированный кристалл.

по интенсивности на 1–2 порядка меньше, чем у исходного, и во всем температурном интервале остается слабо заметной.

При увеличении уровня возбуждения наблюдаются смещение энергии максимума D -полосы в коротковолновую область, линейное увеличение ее интегральной интенсивности и сужение. При этом энергия максимума и полуширина A -полосы не зависят от уровня возбуждения, а B -полоса обнаруживается только при наибольшем уровне возбуждения.

Энергия максимума D -полосы в интервале 77–220 К изменяется немонотонно (рис. 2).

В области низких температур ($T < 140$ К) энергия максимума D -полосы уменьшается по линейному закону:

$$h\nu_{D_1} = h\nu_{D_0} - \alpha_{D_1} T, \quad (1)$$

где $h\nu_{D_0}$, α_{D_1} зависят от уровня возбуждения и принимают значения 1.46 ± 1.47 эВ и $(5 \div 8) \cdot 10^{-4}$ эВ/К соответственно.

Вблизи $T = 140 \div 150$ К она достигает минимального значения. С увеличением уровня возбуждения температура, соответствующая минимуму $h\nu$, слабо смещается в сторону больших значений.

При $T > 150$ К зависимость $h\nu_D$ от температуры аппроксимируется выражением (рис. 3)

$$h\nu_{D_2} = E_g(T) - \alpha_{D_2} \frac{1}{T^2}, \quad (2)$$

где параметр α_{D_2} также зависит от уровня возбуждения. Достоверно определить α_{D_2} удалось только при наибольшем уровне возбуждения и было получено $2.3 \cdot 10^3$ эВ·К².

Полуширина D -полосы с ростом T в интервале 77—220 К линейно увеличивается (рис. 2), причем экстраполированное к абсолютному нулю температуры значение полуширины составляет 40—50 мэВ, а температурный коэффициент $(6.0 \div 8.5) \cdot 10^{-4}$ эВ/К (при разных уровнях возбуждения).

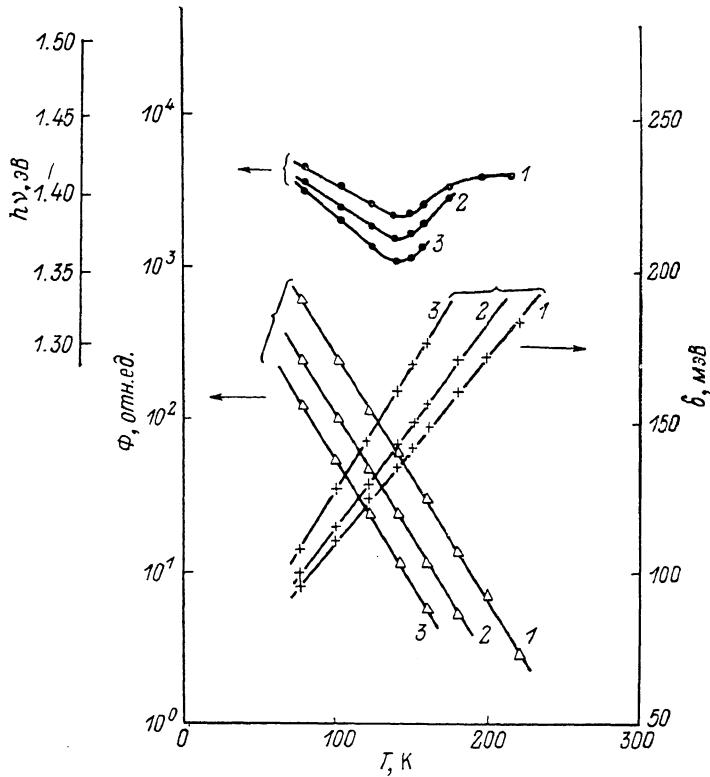


Рис. 2. Температурные зависимости энергии максимума ($h\nu$), интегральной интенсивности (Φ) и полуширины (δ) D -полосы.

Уровень возбуждения, фот/(см²·с): 1 — 10^{-17} , 2 — $6 \cdot 10^{-17}$, 3 — $4 \cdot 10^{-17}$

Интегральная интенсивность D -полосы с ростом T уменьшается и ее изменение аппроксимируется экспонентой вида (рис. 2)

$$\Phi_D = \Phi_{D_0} \exp\left(-\frac{kT}{\epsilon^*}\right), \quad (3)$$

где ϵ^* — характеристическая энергия, которая составляет 2.4 мэВ и не зависит от уровня возбуждения.

4. Известно [6], что немонотонное изменение энергии максимума и экспоненциальное уменьшение интенсивности с повышением температуры свойственны сильно легированным и компенсированным полупроводникам, в которых излучательная рекомбинация обусловлена переходами электронов из хвоста зоны проводимости в хвост валентной зоны.

Образование хвостов плотности состояний возможно и при импульсном лазерном воздействии на GaAs. Действительно, рентгеноструктурный анализ этих кристаллов показал [5], что в приповерхностной области модифицированного кристалла обнаруживается мелкодисперсный Ga, а в глубине его фазы поликристаллического и монокристаллического состояний — GaAs. Образование избыточного Ga свидетельствует о разложении соединения и возгонке

мышьяка. При этом основными дефектами следует ожидать V_{As} , Ga_{As} , Ga . Дефекты вида Ga_{As} , Ga , в кристаллах GaAs выступают в роли доноров, тогда как вакансии As, которые подвижны при $T \geq 200$ °C, выступают в роли акцепторов [7]. Инверсия типа проводимости модифицированного кристалла (с n -типа), которая обнаруживалась нами по измерениям термоэдс, свидетельствует о доминирующей роли V_{As} в них. При этом, по оценкам [6], их концентрация составляет $\sim 2.0 \cdot 10^{19}$ см⁻³. Это означает, что модифицированный кристалл является сильно легированным.

Таким образом, модифицированный кристалл можно рассматривать как сильно легированный компенсированный полупроводник (СЛКП). Кроме того, что кристаллизация модифицированного GaAs происходит с большой скоростью и в неравновесных условиях, возможно «замораживание»

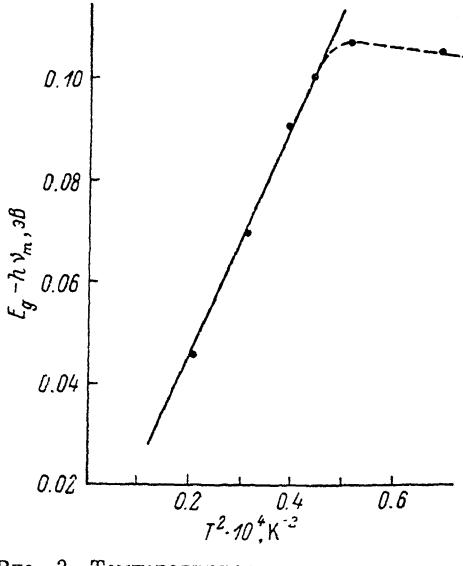


Рис. 3. Температурная зависимость энергии максимума D-полосы в области $T > 150$ К.

Уровень возбуждения $10 \cdot 10^{17}$ фот/(см² · с).

высокотемпературных дефектов и легирующей примеси, что способствует формированию хвостов плотности состояний.

5. Все это дает основание сравнивать экспериментальные результаты с теорией люминесценции СЛКП [6].

Согласно этой теории, основными каналами рекомбинации СЛКП могут быть переходы «хвост—хвост» (ТТ), «зона—хвост» (ВТ) и «хвост—зона» (ТВ). Максимум, обусловленный ТВ переходами, в СЛКП n -типа может вообще не проявиться на фоне излучения, связанного с ВТ переходами, так как при $m_e \ll m_h$ свободные электроны легче туннелируют и их много больше, чем свободных дырок. Наоборот, в СЛКП p -типа ($p \gg n$) ТВ переходы могут определять спектр излучения. Однако интенсивность этого максимума мала, поскольку мала вероятность туннелирования более тяжелых дырок. Наиболее вероятными переходами в СЛКП p -типа являются ТТ переходы, так как при этом вероятность туннелирования тяжелых дырок выше, чем при ТВ переходах.

Проведем подробное сравнение температурных зависимостей параметров D-полосы с теорией [6] для случая ТТ излучательных переходов.

Согласно теории, при ТТ переходах энергия максимума с увеличением температуры изменяется немонотонно и достигает своего минимального значения при T^* , которая при повышении уровня возбуждения должна смещаться в сторону больших температур, что и наблюдается экспериментально. По оцен-

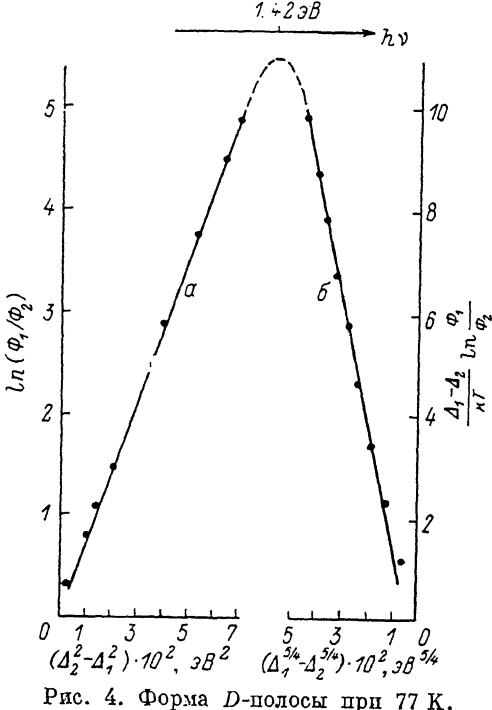


Рис. 4. Форма D-полосы при 77 К.

а — длинноволновый склон ($h\nu < h\nu_m$), б — коротковолновый склон ($h\nu > h\nu_m$). Для удобства сравнения с теорией длинноволновый и коротковолновый склоны представлены в разных координатах. Стрелкой $h\nu$ указано направление возрастания энергии фотонов.

кам [6], для GaAs $T^* = 150 - 200$ К, а экспериментальное значение $T^* = 140 - 150$ К, что находится в хорошем согласии с теорией.

Температурная зависимость энергии максимума при $T < T^*$ обусловлена опустошением глубоких состояний «хвоста» зоны неосновных носителей и должна быть линейной, причем температурный коэффициент $h\nu_m$, должен быть больше температурного коэффициента E_g .

Экспериментальные результаты дают линейную зависимость $h\nu_m(T)$ [см. соотношение (1)] с температурным коэффициентом $\alpha_{D_1} = (5 - 8) \cdot 10^{-4}$ эВ/К, который больше температурного коэффициента E_g [$\alpha_{E_g} = (4.0 - 4.2) \cdot 10^{-4}$ эВ/К], что также говорит о согласии теории с экспериментом.

В области $T > T^*$ излучательная рекомбинация определяется состояниями в хвостах, близких к краям разрешенных зон, которых гораздо больше, чем глубоких состояний. Температурная зависимость энергии максимума при этом должна определяться соотношением

$$h\nu_m = E_g - \lambda I_a (2/3 T_0)^2 \frac{1}{T^2}, \quad (4)$$

где $T = 900$ К — температура замораживания примесей в решетке GaAs, λ — величина порядка единицы. Наблюдаемая экспериментально зависимость [см. соотношение (2)] совпадает с теоретической (4). Сопоставляя коэффициент α_{D_1} в соотношении (2) с его теоретическим выражением в (4), оценили энергию ионизации одиночного акцептора (I_a). При $\lambda \approx 0.3$ эта оценка дала значение, совпадающее с энергией ионизации акцептора в GaAs.

Наблюдаемое экспериментально увеличение энергии максимума с ростом уровня возбуждения также согласуется с теоретическими представлениями, в соответствии с которым оно связано с неравновесным характером распределения неравновесных носителей по состояниям хвостов.

Согласно теории [6], интегральная интенсивность излучательной рекомбинации при ТТ переходах с ростом T должна экспоненциально уменьшаться, что обусловлено термическим опустошением все более глубоких состояний в хвостах зон. Однако проведение детального сравнения экспериментальной зависимости (3) с теоретической оказалось затруднительным ввиду громоздкости аналитического выражения для $\Phi(T)$.

Таким образом, температурные зависимости основных параметров D -полосы, наблюдавшиеся экспериментально, функционально совпадают с теоретическими для ТТ излучательных переходов. Это дает основание сравнивать форму спектра D -полосы с ожидаемой теоретически.

В коротковолновой области ($h\nu > h\nu_m$), согласно теории [6], спад $\Phi(h\nu)$ определяется температурой и должен иметь вид

$$\Phi(h\nu) = \Phi_0 \exp\left(\frac{\Delta}{kT} - A_{D_1} \Delta^{1/4}\right), \quad (5)$$

где

$$A_{D_1} = \frac{2\sqrt{\pi}}{5I_d^{1/4}(Na_e^3)^{1/4}}, \quad (5a)$$

$$\Delta = E_g(T) - h\nu. \quad (5b)$$

Из выражения (5) следует, что в координатах $\left[\frac{\Delta_1 - \Delta_2}{kT} - \ln \frac{\Phi_1}{\Phi_2}\right]$ и $[\Delta_1^{1/4} - \Delta_2^{1/4}]$ зависимость $\Phi(h\nu)$ должна представлять собою прямую линию, где Φ_1 , Φ_2 — интенсивности при некоторых значениях $h\nu_1$ и $h\nu_2$, а Δ_1 , Δ_2 определяются из (5b) при соответствующих значениях $h\nu_1$ и $h\nu_2$. При построении графика на рис. 4 $h\nu_1$ было фиксировано, а $h\nu_2$ изменялось.

При 77 К, когда интенсивность D -полосы является преобладающей, спад $\Phi(h\nu)$ в коротковолновой области удовлетворительно аппроксимируется выражением (5) (рис. 4, кривая 6). Коэффициент A_{D_1} , определенный по ее наклону, оказался равным 245 эВ $^{-1}$, что по (5a) соответствует энергии ионизации одиночного донора $I_d = 3.8$ мэВ и близко энергии мелкого донора в GaAs.

В длинноволновой области ($h\nu < h\nu_m$), согласно теории, вид спектра излучения определяется спадом плотности состояний в глубь запрещенной зоны и может быть записан в виде

$$\Phi(h\nu) = \Phi_0 \exp\left(-\frac{\Delta^2}{2\gamma^2}\right), \quad (6)$$

в координатах $\ln(\Phi_1/\Phi_2)$ и $(\Delta_2^2 - \Delta_1^2)$ зависимость $\Phi(h\nu)$ должна представлять собою прямую линию ($\Phi_1, \Phi_2, \Delta_1, \Delta_2$ имеют указанный выше смысл).

Экспериментальная зависимость подтверждает ожидаемую теоретически и описывается выражением (6) (рис. 4, кривая *a*). Эффективная глубина хвостов плотности состояний (γ), определенная по ее наклону при 77 К, составляет 86 мэВ, что удовлетворительно согласуется с величиной среднеквадратичной флуктуации потенциала в GaAs [8].

Таким образом, вся совокупность экспериментальных данных дает основание считать, что D -полоса в модифицированных лазерным излучением кристаллах GaAs обусловлена излучательной рекомбинацией через хвосты плотности состояний и согласуется с теорией люминесценции СЛКП Леванюка—Осипова.

Выражаем свою искреннюю благодарность В. В. Осипову за обсуждение результатов работы.

Список литературы

- [1] Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 10. С. 1880—1882.
- [2] Наследов Д. Н., Царенков Б. В. / Тр. IX Междунар. конф. по физике полупроводников. М., 1968.
- [3] Logan R. M. // J. Phys. Chem. Sol. 1971. V. 32. P. 1755.
- [4] Kressel H., Nelson H., Nawrylo F., Dunse J. // J. Appl. Phys. 1968. V. 39. N 4. P. 2006—2011.
- [5] Андреева В. Д., Анисимов М. И., Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 6. С. 1010—1013.
- [6] Леванюк А. П., Осипов В. В. // УФН. 1981. Т. 133. В. 3. С. 427—477.
- [7] Емцев В. В., Машовец Т. В. Примеси и точечные дефекты в полупроводниках. М., 1981. 246 с.
- [8] Эфрос А. Л. // УФН. 1973. Т. 111. В. 3. С. 451—482.

Ленинградский технический
университет

Получена 4.05.1990
Принята к печати 10.09.1990